

# 会員制有償講座

## 2024年度「半導体デバイスプロセス技術基礎講座」ご案内

於大阪公立大学i-siteなんば および

オンライン

化学機械研 (CMP) 技術概要と  
半導体洗浄技術の基礎とCMP洗浄とは

Looking ahead  
going beyond expectations

第1回 4/24 : 最新の国内・世界の半導体および市場動向と展望	モルガンスタンレーMUFJ証券	和田木氏 (参加230名)
第2回 5/9 : ALD/ALEプロセスの基礎と応用	東京大学	霜垣教授(参加172名)
第3回 5/20 : リソグラフィの基礎と最先端の現状	東京エレクトロン	永原氏 (参加225名)
第4回 6/7 : プラズマエッチングの基礎と最先端の現状	名古屋大学	堀 特任教授(参加227名)
第5回 7/19 : パワーデバイスの基礎と最新動向	パナソニックインダストリー	上田氏
第6回 8/9 : 半導体設計技術と最新AI動向	富山県立大学	吉河武文教授
第7回 8/30 : 半導体接合の基礎と最先端動向	横浜国立大	井上准教授岩
第8回 9/27 : 洗浄技術基礎と最先端状況	Screen	畑氏
第9回 10/7 :		
第10回 10/21:		
以降 15回開催予定		